(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-180021 (P2002-180021A)

(43)公開日 平成14年6月26日(2002.6.26)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 9 J 163/00		C 0 9 J 163/00	4J004
C 0 8 G 59/62		C 0 8 G 59/62	4J036
C 0 9 J 7/00		C 0 9 J 7/00	4 J 0 4 0
133/00		133/00	5 F 0 4 4
161/14		161/14	
	審查請求	未請求 請求項の数9 OL	(全 10 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧2000-384608(P2000-384608)	(71)出顧人 000004455	
		日立化成工業	株式会社
(22)出顧日	平成12年12月19日(2000.12.19)	東京都新宿区	西新宿2丁目1番1号
		(72)発明者 宇留野 道生	
		千葉県市原市	五井南海岸14番地 日立化成
		工業株式会社	五井事業所内
		(72)発明者 柳沢 論	
		千葉県市原市	五井南海岸14番地 日立化成
		工業株式会社	五井事業所内
		(72)発明者 細川 羊一	
		千葉県市原市	五井南海岸14番地 日立化成
		工業株式会社	五井事業所内
			最終頁に続く

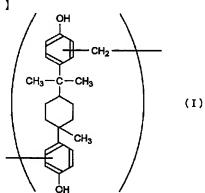
(54)【発明の名称】 接着剤組成物、これを用いた接着フィルム、半導体チップ搭載用基板及びこれを用いた半導体装

(57)【要約】

【課題】 半導体パッケージ用部材としての信頼性に優れた接着剤組成物、これを用いた接着フィルム及びこの接着フィルムを用いた半導体装置を提供する。

【解決手段】 (1)分子内に2個以上のエポキシ基を有するエポキシ樹脂及び(2)硬化剤として下記一般式(I)で示される構造単位を有するテルペンフェノールノボラック樹脂を合わせて100重量部並びに

【化1】



(3)カルボキシル基、ヒドロキシル基、酸無水物基、アミド基又はエボキシ基を有するアクリル系共重合体50~300重量部を含有する接着剤組成物、この組成物を用いた接着フィルム及び接着フィルムを用いた半導体装置。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (1)分子内に2個以上のエポキシ基を 有するエポキシ樹脂及び(2)硬化剤として下記一般式 (I)で示される構造単位を有するテルペンフェノール ノボラック樹脂を合わせて100重量部並びに

【化1】

(3) カルボキシル基、ヒドロキシル基、酸無水物基、 アミド基又はエポキシ基を有するアクリル系共重合体5 0~300重量部を含有する接着剤組成物。

【請求項2】 (3)のアクリル系共重合体のガラス転 移点 (Tg) が-20℃~30℃であり、重量平均分子 量が10,000~2,000,000で、エポキシ基 を有する請求項1に記載の接着剤組成物。

【請求項3】 さらに(4)硬化促進剤0.01~10 重量部を配合した請求項1又は2に記載の接着剤組成 物。

【請求項4】 さらに(5)カップリング剤0.1~1 0重量部を配合した請求項1~3のいずれかに記載の接 着剤組成物。

【請求項5】 さらに(6)イオン捕捉剤0.01~1 0重量部を配合した請求項1~4のいずれかに記載の接 着剤組成物。

【請求項6】 さらに(7)溶剤を配合した請求項1~ 5のいずれかに記載の接着剤組成物。

【請求項7】 請求項1~6のいずれかに記載の接着剤 組成物をフィルム化した接着フィルム。

【請求項8】 請求項7に記載の接着フィルムを有機系 支持基板に接着した半導体チップ搭載用基板。

【請求項9】 請求項8に記載の接着フィルムを用いた 40 半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体パッケージ 用部材としての信頼性に優れた接着剤組成物、これを用 いた接着フィルム、半導体チップ搭載用基板及びこれを 用いた半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の小型化に伴い、これに

されるようになり、小型化・軽量化が進むと共に、CS P (チップサイズパッケージ) やμBGA (ボールグリ ッドアレイ)と呼ばれる小型パッケージの開発が進めら れている。

【0003】各種電子部品を搭載した実装基板の重要特 性の一つとして信頼性があるが、特に接続信頼性は実装 基板を用いた機器の品質に直接関係するため、非常に重 要な項目となっている。この接続信頼性を低下させる原 因としては、半導体チップと電子部品を実装する基板の 10 熱膨張係数の差から生じる熱応力が挙げられる。これは 半導体チップの熱膨張係数が約4ppm/℃と小さいの に対し、電子部品を実装する配線板の熱膨張係数が15 ppm/℃以上と大きいことから、熱衝撃により生じる 歪みが発生した際、その歪みによって熱応力が発生する ものである。例えばベアチップ実装においては、半導体 チップの電極と配線板の配線パッドを接続するはんだボ ール部分に熱応力が集中し、接続信頼性が低下される。 この熱応力の分散にはアンダーフィルと呼ばれる樹脂を チップと配線板の間に注入することが有効とされるが、 20 実装工程の増加、コストアップの原因となっている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】これらの対応策とし て、CSPには多くの構造が提案されており、例えばμ BGAにおいては半導体チップとインターポーザと呼ば れる配線基板との間には、それぞれの熱膨張率差から生 じる熱応力を低減できるよう、低弾性の絶縁性接着剤が 用いられる。近年、このような分野に適した絶縁性の接 着剤としては低弾性の接着フィルムが作業性も良く接続 信頼性も高いといった報告(公開WO98/15975 30 号)がされている。低弾性接着フィルムに要求される物 性としては、チップと配線基板の熱応力低減の他、接着 性、温度サイクル性、耐湿性等がある。また、さらに近 年においては接着剤の保存安定性やチップ圧着時の生産 性を向上させる要求が高まりつつある。

【0005】接着フィルムはフレキシブルプリント配線 板等で用いられており、接着剤にアクリルゴム、アクリ ロニトリルブタジエンゴム等の各種ゴムを主成分とする 系が多く用いられている。これらのゴムは、接着剤の強 度、可撓性及び密着性を改善するために使用されてい る。

【0006】これらのうち、アクリルゴムを主成分とす る系では、高温長時間処理後の接着力の低下は比較的小 さいが、高温時の接着強さが不十分である他、吸湿時の 特性低下が大きいという欠点があった。また、アクリロ ニトリルブタジエンゴムを主成分とする系では、高温長 時間処理後の接着力の低下が大きいことや、耐電食性に 劣るなどの欠点があった。特に、半導体関連部品の信頼 性評価で用いられるPCT (プレッシャークッカーテス ト) 処理等の厳しい条件下で耐湿性試験を行った場合の 搭載する半導体パッケージは基板への高密度実装が要求 50 劣化が大きかった。吸湿後のはんだ耐熱性を向上させた

20

ものとしては、特開昭60-243180号公報に示さ れるアクリル系樹脂、エポキシ樹脂、ポリイソシアネー ト及び無機フィラーを含む接着剤があり、また特開昭6 1-138680号公報に示されるアクリル系樹脂、エ ポキシ樹脂、分子中にウレタン結合を有する両末端が第 1級アミン化合物及び無機フィラーを含む接着剤があ る。しかしながら、これらの接着剤を用いて半導体チッ プをプリント配線板に実装する場合には、半導体チップ とプリント配線板の熱膨張係数の差が大きくリフロー時 にクラックが発生し、温度サイクルテストやPCT処理 10 等の厳しい条件下での耐湿性試験を行った場合の劣化が 大きくなる。

【0007】また、ゴムーエポキシ樹脂系接着剤におい て、反応性を有するアクリルゴム、アクリロニトリルブ タジエンゴム等をエポキシ樹脂に混合した接着剤があ り、これらの接着剤は、高温接着性等が改善されてい る。反応性ゴム系接着剤として反応性アクリル系接着剤 は、特開平3-181580号公報に示されるように、 カルボキシル基、ヒドロキシル基、エポキシ基含有アク リルエラストマ及びアルキルフェノール、エポキシ樹 脂、イミダゾリウムトリメリテートからなる接着剤組成 物があり、フレキシブル印刷配線板のベースフィルムと 銅箔とを接着する分野に用いられる。また光沢面との接 着性、耐熱性を向上させたものとして特開平7-766 79号公報のエポキシ基を有するアクリルエラストマ6 0~80重量部及びアルキルフェノール8~20重量 部、エポキシ樹脂8~20重量部、イミダゾール系硬化 剤0.2~1.0重量部を必須成分とする抵抗回路付き シートヒーター用接着剤組成物がある他、特開平7-1 73449号公報に示されるように、エポキシ基含有ア 30 クリルエラストマ系接着剤組成物がある。

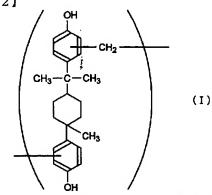
【0008】しかしながら、これらの高温接着性の改良 された接着フィルムでも、鉛フリーはんだを想定した2 60℃における接着性が不十分であり、また、接着フィ ルムと基板や半導体チップを貼り付ける際に硬化剤の一 部が揮発して、基材や半導体チップ等を汚染するといっ た問題点を生じていた。

【0009】本発明は、ガラスエポキシ基板、フレキシ ブル基板等のインターポーザと呼ばれる配線基板に熱膨 張係数の差が大きい半導体チップを実装する場合に必要 40 な耐熱性、耐湿性、高温接着性等の信頼性を有し、かつ 保存安定性に優れた接着剤組成物、これを用いた接着フ ィルム、この接着フィルムを用いた半導体チップ搭載用 基板及びこれを用いた半導体装置を提供するものであ る。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は(1)分子内に 2個以上のエポキシ基を有するエポキシ樹脂及び(2) **硬化剤として下記一般式(I)で示される構造単位を有** 0重量部並びに

【化2】



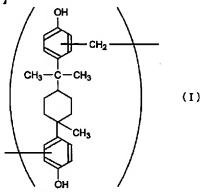
(3)カルボキシル基、ヒドロキシル基、酸無水物基、 アミド基又はエポキシ基を有するアクリル系共重合体5 0~300重量部を含有する接着剤組成物に関する。ま た、本発明は、この接着剤組成物を用いた接着フィル ム、この接着フィルムを有機系支持基板に接着した半導 体チップ搭載用基板及びこの基板を用いた半導体装置に 関する。

【0011】本発明における(1)分子内に2個以上の エポキシ基を有するエポキシ樹脂としては硬化して接着 作用を呈するものであれば良く、二官能及び/又は多官 能のエポキシ樹脂を用いることができる。二官能エポキ シ樹脂としては、室温で液状のものと固体のものがあ り、これらの樹脂は市場から容易に入手することができ る。例えば、エピコート827,828,834,10 01, 1004, 1007, 1009, 1010 (以上 油化シェルエポキシ(株)製)、アラルダイトGY25 2, 250, 260, 280, 6099 (以上チバ・ガ イギー (株) 製)、D. E. R330, 331, 33 6,337,668,669(以上ダウ・ケミカル (株)製)、YD8125、YDF170(以上東都化 成(株)製)等が挙げられる。多官能エポキシ樹脂とし ては、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾー ルノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールAノボラ ックエポキシ樹脂、α-ナフトールノボラックエポキシ 樹脂、臭素化ノボラックエポキシ樹脂等があり、これら の樹脂も市場から容易に入手することができる。例え ば、DEN-431, 438, 439 (以上ダウ・ケミ カル (株) 製)、エピコート152, 154 (以上油化 シェルエポキシ (株) 製)、EPPN-201, 202 (以上日本化薬(株)製)等のフェノールノボラックエ ポキシ樹脂、EOCN-102S, 103S, 104 S, 1020, 1025, 1027 (以上日本化薬 (株)製)、ESCN-001, 195X, 200S, 220 (以上住友化学工業 (株) 製)、YDCN-70 3 (東都化成(株)製)等のクレゾールノボラックエポ キシ樹脂、N-865, N-880 (以上大日本インキ するテルペンフェノールノボラック樹脂を合わせて10 50 化学工業(株)製)等のビスフェノールAノボラックエ

5

ポキシ樹脂、EXB-4300(大日本インキ化学工業 (株) 製) 等のαーナフトールノボラックエポキシ樹 脂、BREN-S(日本化薬(株)製)等の臭素化フェ ノールノボラックエポキシ樹脂などが挙げられる。 【0012】本発明においては、エポキシ樹脂は1種類 のみで用いても、2種類以上を組み合わせてもよい。 【0013】本発明における硬化剤としての下記一般式 (I)で示される構造単位を有するテルペンフェノール ノボラック樹脂は、市場から容易に入手することができ る。例えば、エピキュアMP402(油化シェルエポキ 10 ルニルメチル、アクリル酸アダマンチル、アクリル酸ト シ(株)製)等がある。

【化3】



【0014】本発明におけるエポキシ樹脂及び硬化剤の 総量を100重量部とすると、エポキシ樹脂は40~9 0重量部であり、好ましくは50~80重量部である。 エポキシ樹脂の量が少なすぎると接着性が不十分となる 傾向があり、多すぎると耐熱性が不十分となる傾向があ る。

【0015】また本発明においては硬化剤として、上記 30 のテルペンフェノールノボラック樹脂の他に、本発明の 効果を損なわない程度に他のエポキシ樹脂の硬化剤とし て多官能フェノール樹脂を併用することができる。多官 能フェノール樹脂としては、フェノール性水酸基を1分 子中に2個以上有する化合物であるビスフェノールA、 ビスフェノールF、ビスフェノールS、臭素化ビスフェ ノールA、臭素化ビスフェノールF、フェノールノボラ ック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ビスフェノール Aノボラック樹脂等があり、市場から容易に入手するこ とができる。例えば、ファイヤーガードFG2000 (帝人化成(株)製)等の臭素化ビスフェノールA、フ ェノライトLF2882、LF2822、TD-209 0、TD-2149、VH4150、VH4170(以 上大日本インキ化学工業(株)製)、PSM-4300 (群栄化学(株)製)H-100(明和化成(株)製) 等のノボラック樹脂等が挙げられる。これらの硬化剤は 硬化剤の総量を100重量部とした場合に20重量部以 下の範囲で用いることが好ましい。これらの量が多すぎ ると保存安定性及び低温硬化性が不十分となる傾向があ る。

【0016】本発明における(3)カルボキシル基、ヒ ドロキシル基、酸無水物基、アミド基又はエポキシ基を 有するアクリル系共重合体としては、以下に示すような 非官能性モノマーと官能性モノマーを共重合することに より得られる。

【0017】非官能性モノマーとしては、例えば、アク リル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、 アクリル酸2-エチルヘキシル等のアクリル酸アルキル エステル、アクリル酸ノルボルニル、アクリル酸ノルボ リシクロ[5.2.1.0^{2,6}] デカン-8-イル、ア クリル酸トリシクロ[5.2.1.0²,6] デカン-3 (又は4) -イルメチル、アクリル酸ボルニル、アクリ ル酸イソボルニル、アクリル酸メチルシクロヘキシル等 のアクリル酸シクロアルキルエステル、アクリル酸フェ ニル、アクリル酸ベンジル等のアクリル酸芳香族エステ ル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタク リル酸ブチル、メタクリル酸2-エチルヘキシル等のメ タクリル酸アルキルエステル、メタクリル酸ノルボルニ 20 ル、メタクリル酸ノルボルニルメチル、メタクリル酸ア ダマンチル、メタクリル酸トリシクロ[5.2.1.0] 2,6] デカン-8-イル、メタクリル酸トリシクロ [5.2.1.0 2,6] デカン-3(又は4) -イルメ チル、メタクリル酸ボルニル、メタクリル酸イソボルニ ル、メタクリル酸メチルシクロヘキシル、メタクリル酸 シクロヘキシル等のメタクリル酸シクロアルキルエステ ル、メタクリル酸フェニル、メタクリル酸ベンジル等の メタクリル酸芳香族エステル、スチレン又はαーメチル スチレン、αーエチルスチレン等のαー置換スチレン、 クロロスチレン、ビニルトルエン、セーブチルスチレン 等の核置換スチレン、N-メチルマレイミド、N-エチ ルマレイミド、Nープロピルマレイミド、Nープチルマ レイミド等のN-アルキル基置換マレイミド、N-シク ロヘキシルマレイミド等のN-シクロアルキル基置換マ レイミド、Nーフェニルマレイミド等のNーアリール基 置換マレイミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリ ル等のシアン化ビニル化合物からなる群より選ばれる少 なくとも1種の化合物を使用することができる。非官能 性モノマーは、共重合体のTgが-20℃~30℃とな るように選択することが好ましく、-10℃~20℃と なることが好ましい。Tgが低すぎるとBステージ状態 での接着フィルムのタック性が大きくなり取扱性が悪化 する傾向があり、高すぎると接着性が不十分となる傾向 がある。

【0018】また、官能性モノマーとしては、例えば、 アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸等のカルボキシ ル基酸含有モノマー、アクリル酸-2-ヒドロキシエチ ル、メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル、アクリル酸 -2-ヒドロキシプロピル、メタクリル酸-2-ヒドロ 50 キシプロピル、N-メチロールアクリルアミド、N-メ

チロールメタクリルアミド、(o-, m-, p-)ヒド ロキシスチレン等のヒドロキシル基含有モノマー、無水 マレイン酸等の酸無水物基含有モノマー、アクリルアミ ド、メタクリルアミド等のアミド基含有モノマー、アク リル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル、α-エチ ルアクリル酸グリシジル、 $\alpha - n - プロピルアクリル酸$ グリシジル、α-n-ブチルアクリル酸グリシジル、ア クリル酸-3,4-エポキシブチル、メタクリル酸-3,4-エポキシブチル、アクリル酸-4,5-エポキ シペンチル、メタクリル酸-4,5-エポキシペンチ ル、アクリル酸-6,7-エポキシヘプチル、メタクリ ル酸-6, 7-エポキシヘプチル、α-エチルアクリル 酸-6,7-エポキシヘプチル、アクリル酸-3-メチ ルー3,4-エポキシブチル、メタクリル酸-3-メチ ルー3,4-エポキシブチル、アクリル酸-4-メチル -4,5-エポキシペンチル、メタクリル酸-4-メチ ル-4,5-エポキシペンチル、アクリル酸-5-メチ ルー5,6-エポキシヘキシル、メタクリル酸-5-メ チル-5,6-エポキシヘキシル、アクリル酸-β-メ **チルグリシジル、メタクリル酸-β-メチルグリシジ** ν 、 α -エチルアクリル酸- β -メチルグリシジル、ア クリル酸-3-メチル-3, 4-エポキシブチル、メタ クリル酸-3-メチル-3、4-エポキシブチル、アク リル酸-4-メチル-4、5-エポキシペンチル、メタ クリル酸-4-メチル-4,5-エポキシペンチル、ア クリル酸-5-メチル-5,6-エポキシヘキシル、メ タクリル酸-5-メチル-5,6-エポキシヘキシル等 のエポキシ基含有モノマーからなる群より選ばれる少な くとも1種の化合物を使用することができる。例えば、 HTR-860P-3 (帝国化学産業(株)製、エポキ 30 シ基含有アクリルゴム、重量平均分子量800,00 0)が用いられる。これらのうち、保存安定性の点でエ ポキシ基含有モノマーが好ましく、メタクリル酸グリシ ジルがより好ましい。

【0019】非官能性モノマーと官能性モノマーとの共 重合比(非官能性モノマー/官能性モノマー)はこれら の総量を100重量部として好ましくは90/10~9 9.9/0.1重量部の範囲であり、より好ましくは9 3/7~99.5/0.5の範囲であり、さらに好まし くは95/5~99/1の範囲である。官能性モノマー 40 の量が多すぎると共重合する際にゲル化しやすくなる傾 向があり、少なすぎると接着性が不十分となる傾向があ る。これらのアクリル系共重合体を得るための重合法と しては、塊状重合、パール重合、乳化重合、溶液重合等 が挙げられる。また、これらのアクリル系共重合体の分 子量としては重量平均分子量(Mw)が好ましくは1 0、000~2、000、000であり、より好ましく は30、000~1、500、000であり、さらに好 ましくは50、000~1、000、000である。分 子量が大きすぎると共重合する際にゲル化しやすくなる 50

傾向があり、小さすぎると接着性が不十分となる傾向がある。Tgが-20℃~30℃、重量平均分子量が10,000~2,000,000及びエポキシ基を有するアクリル系共重合体が好ましい。

【0020】本発明における(3)カルボキシル基、ヒドロキシル基、酸無水物基、アミド基又はエボキシ基を有するアクリル系共重合体の量は、エボキシ樹脂及び硬化剤の総量の100重量部に対して50~300重量部であり、好ましくは80~300重量部である。アクリル系共重合体の量が少なすぎると接着性が低下する傾向があり、多すぎるとタック性が高くなりすぎて取り扱いにくくなる傾向がある。

【0021】さらに本発明においては、保存安定性を損 なわない程度に(4)硬化促進剤を用いることが好まし い。硬化促進剤としては、通常エポキシ樹脂の硬化に際 して用いられるものが使用できる。具体的には、塩酸等 の無機酸、酢酸、シュウ酸等の有機酸、トリエチルアミ ン、ベンジルジメチルアミン等の第三級アミン類、1-ベンジルー2ーメチルイミダゾール、2-エチルー4-メチルイミダゾール、1-シアノエチル-2-エチルー 4-メチルイミダゾール等のイミダゾール類、トリフェ ニルホスフィン等のホスフィン類、BF3 等のルイス酸 又はルイス酸塩等を挙げることができ、保存安定性や耐 熱性等の点で好ましくはイミダゾール類が用いられる。 イミダゾール類は、市場から容易に入手することがで き、例えば、2E4MZ、1B2MZ、2E4MZ-C N、2PZ-CN、2PZ-CNS(以上四国化成工業 (株)製)等がある。

【0022】また、硬化促進剤の配合量は、エポキシ樹脂及び硬化剤の総量の100重量部に対して好ましくは0.01~10重量部であり、より好ましくは0.1~5重量部である。硬化促進剤が多すぎると保存安定性や接着性が低下する傾向がある。

【0023】さらに本発明においては、異種材料間の界面結合をよくするために、(5)カップリング剤を配合することもできる。カップリング剤としては、シランカップリング剤が好ましい。シランカップリング剤としては、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、アーアミノプロピルトリエトキシシラン、アーウレイドプロピルトリエトキシシラン、N-β-アミノエチルーアーアミノプロピルトリメトキシシラン等が挙げられる。

【0024】前記したシランカップリング剤は、市場から容易に入手することができ、例えば、NUC A187、A-189、A-1160、A-1120(以上日本ユニカー(株)製)、SH6040、SH6062、SH6020(以上東レ・ダウコーニング・シリコーン(株)製)等がある。

ましくは50,000~1,000,000である。分 【0025】カップリング剤の配合量は、エポキシ樹脂 子量が大きすぎると共重合する際にゲル化しやすくなる 50 及び硬化剤の総量の100重量部に対して好ましくは

0.01~10重量部、より好ましくは0.1~5重量 部とされる。添加量が少なすぎる場合には接着性が十分 に向上しない傾向があり、多すぎる場合には耐熱性が低 下する傾向がある。

【0026】さらに本発明においては、イオン性不純物 を吸着して、吸湿時の絶縁信頼性をよくするために、

(6)イオン捕捉剤を配合することができる。イオン捕 捉剤としては、銅がイオン化してとけ出すのを防止する ため銅害防止剤として知られる化合物、例えば、トリア ることもできる。ビスフェノール系還元剤としては、 2, 2'-メチレンービス-(4-メチル-6-第3ブ チルフェノール)、4,4'ーチオービスー(3-メチ ルー6-第3ブチルフェノール) 等が挙げられる。トリ アジンチオール化合物を成分とする銅害防止剤は、三協 製薬株式会社から、ジスネットDBという商品名で市販 されている。またビスフェノール系還元剤を成分とする **銅害防止剤は、吉富製薬株式会社から、ヨシノックスB** Bという商品名で市販されている。

【0027】また、無機イオン吸着剤としては、東亜合 20 成化学工業(株)からジルコニウム系化合物を成分とす るものがIXE-100という商品名で、アンチモンビ スマス系化合物を成分とするものがIXE-600とい う商品名で、マグネシウムアルミニウム系化合物を成分 とするものがIXE-700という商品名で市販されて いる。また、ハイドロタルサイトは、協和化学工業か ら、DHT-4Aという商品名で市販されているものが

【0028】これらイオン捕捉剤の配合量はエポキシ樹 脂及び硬化剤の総量の100重量部に対して好ましくは 30 0.01~10重量部、より好ましくは0.1~5重量 部とされる。添加量が少なすぎる場合にはイオン捕捉能 力が十分に作用しない傾向があり、多すぎる場合には耐 熱性が低下する傾向がある。

【0029】本発明の接着剤組成物は、各成分を(7) 溶剤に溶解・分散したワニスをそのまま使用するほか、 ワニスを基材上に塗布し、加熱して溶剤を除去してフィ ルムとして使用することが可能である。ワニス化の溶剤 は、比較的低沸点の、メチルエチルケトン、アセトン、 メチルイソブチルケトン、2-エトキシエタノール、ト 40 ルエン、ブチルセロソルブ、メタノール、エタノール、 2-メトキシエタノール等を用いるのが好ましい。ま た、塗膜性を向上する等の目的で、高沸点溶剤を加えて もよい。高沸点溶剤としては、ジメチルアセトアミド、 ジメチルホルムアミド、メチルピロリドン、シクロヘキ サノン等が挙げられる。ワニスの製造は、本発明の構成 成分を上記溶剤に溶解することが可能な装置であれば特 に制限はなく、攪拌機等を備えた溶解槽等を用いて行わ れる。溶解は通常室温~150℃、好ましくは室温~1

解温度が高すぎると溶解中にエポキシ基等が反応して、 接着性を低下させる傾向がある。

【0030】また、ワニスとした後、真空脱気によりワ ニス中の気泡を除去することが好ましい。基材として は、ポリエステルフィルム、ポリエチレンフィルム、ポ リプロピレンフィルム、ポリイミドフィルム等やそれら を離型処理したフィルム等を使用することができる。塗 工方法は特に制限するものではないが、例えば、ロール コート、リバースロールコート、グラビアコート、バー ジンチオール化合物、ビスフェノール系還元剤を配合す 10 コート等が挙げられる。また、基材の両面に接着剤層を 有する接着フィルムは、基材のそれぞれの面に接着剤を 塗布、加熱して溶剤を除去して得られる。また耐熱性フ ィルム上に塗布した接着剤層を基材の両面にラミネーシ ョンで貼り合わせることにより得ることができる。この 時、ラミネートの圧力は接着フィルムの変形が起こらな い圧力で行うことが好ましい。両面に接着層を形成する 場合は、片面と他面の接着剤の厚みが異なっていてもよ

> 【0031】本発明になる接着フィルムの接着剤層を形 成する際には、加熱により溶剤を除去するが、この時、 接着剤の組成物の硬化反応が進んでゲル化してくる。そ の際の硬化状態が接着剤の流動性に影響し、接着性や取 り扱い性を適性化する。DSC (示差走査熱量測定) は、測定温度範囲内で、発熱、吸熱のない標準試料との 温度差をたえず打ち消すように熱量を供給、又は除去す るゼロ位法を測定原理とするものであり、測定装置が市 販されており、それを用いて測定できる。本発明の接着 剤組成物の反応は、発熱反応であり、一定の昇温速度で 試料を加熱していくと、試料が反応し熱量が発生する。 その発熱量をチャートに出力し、ベースラインを基準と して発熱曲線とベースラインで囲まれた面積を求め、こ れを発熱量とする。室温から250℃まで10℃/分の 昇温速度で測定し、上記の発熱量を求める。次に、上記 基材に塗布し、乾燥して得た接着剤の発熱量は次のよう にして求める。まず、25℃で真空乾燥器を用いて溶剤 を乾燥させた未硬化試料の全発熱量を測定し、これをA (J/g)とする。次に塗工、乾燥した試料の発熱量B を測定し、試料の硬化度C(%)(加熱、乾燥により発 熱を終えた状態)は、次の数1で与えられる。

> 【数1】C(%) = $(A-B) \times 100/A$ 【0032】接着フィルムの硬化度については、DSC を用いて測定した場合の前硬化発熱量の10~40%の 発熱を終えた状態にすることが好ましい。

【0033】硬化度が10%未満の場合、網目構造が十 分に発生していないため、流動性が大きすぎる状態で被 着面と接着するため、接着性が低下する傾向がある。ま た、硬化度が40%を越えると、網目構造が密になり、 逆に流動性がなくなりすぎて接着性が低下する傾向があ

20℃の範囲で通常1時間~50時間程度行われる。溶 50 【0034】さらに本発明の接着剤組成物には、本発明

の効果を損なわない程度に、その他の成分を混合して使 用することができる。このような成分としては、フェノ キシ樹脂、官能基含有アクリロニトリルーブタジエンゴ ム、無機フィラー等がある。

【0035】フェノキシ樹脂は、Bステージにおけるタ ック性の低減や、硬化後の接着剤の可撓性付与等を目的 として混合することができる。フェノキシ樹脂は、市場 から容易に入手することができる。例えば、フェノトー トYP-40、YP-50、YP-60(以上東都化成 (株)製)等がある。フェノキシ樹脂の配合量はエポキ 10 シ樹脂及び硬化剤の総量の100重量部に対して好まし くは20重量部以下、より好ましくは10重量部以下の 範囲で混合される。混合量が多すぎる場合には耐熱性が 低下する傾向がある。

【0036】官能基含有アクリロニトリルーブタジエン ゴムとしては、カルボキシル基等の官能基を付加したア クリロニトリルーブタジエンゴムが挙げられ、タック性 の低減や、硬化後の接着剤の可撓性付与等を目的として 混合することができる。このような官能基含有アクリロ ニトリルーブタジエンゴムは、市場から容易に入手する 20 良好である。 ことができる。例えば、PNR-1(日本合成ゴム (株) 製)、ニポール1072(日本ゼオン(株)製) 等がある。このような官能基含有アクリロニトリルーブ タジエンゴムの配合量は、エポキシ樹脂及び硬化剤の総 量の100重量部に対して、好ましくは20重量部以 下、より好ましくは10重量部以下の範囲とされる。 混 合量が多すぎる場合には耐熱性やPCT処理後の接着性

【0037】無機フィラーは、熱伝導性、難燃性、チキ ソトロピー性等を付与する目的で混合することができ る。無機フィラーとしては、水酸化アルミニウム、水酸 化マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、 ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、酸化カルシウ ム、酸化マグネシウム、アルミナ、窒化アルミニウム、 ホウ酸アルミニウムウイスカ、窒化ホウ素、結晶性シリ カ、炭化ケイ素等が挙げられる。

が低下する傾向がある。

【0038】熱伝導性をよくするためには、アルミナ、 窒化アルミニウム、窒化ホウ素、結晶性シリカ、非晶性 シリカ、炭化ケイ素等が特に好ましい。この内、アルミ ナは放熱性がよく、耐熱性、絶縁性が良好な点で好適で 40 ある。また、結晶性シリカ又は非晶性シリカは、耐熱性 の点ではアルミナより劣るが、イオン性不純物が少ない ため、PCT処理後の絶縁性が高く、銅箔、アルミ線、 アルミ板等の腐食が少ない点で好適である。また、難燃 性を与えるためには、水酸化アルミニウム、水酸化マグ ネシウム、アンチモン酸化物等が好ましい。さらに、チ キソトロピー性の付与の目的には、水酸化アルミニウ ム、水酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネ シウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、酸化 カルシウム、酸化マグネシウム、アルミナ、結晶性シリ 50 (株)製商品名、キュアゾール2PZ-CNを使用)

カ、非晶性シリカ等が好ましい。これらの無機フィラー はエポキシ樹脂及び硬化剤の総量の100重量部に対し て、好ましくは100重量部以下、より好ましくは60 重量部以下の範囲で混合するのが好ましい。混合量が多 すぎる場合には接着剤の貯蔵弾性率の上昇、接着性の低 下などを起こす傾向がある。本発明になる接着フィルム を所定の配線と外部接続用端子が形成されている有機系 支持基板に接着して半導体チップ搭載用基板とされ、こ れを用いて半導体装置が製造される。

【0039】以上をまとめると、本発明の接着剤組成物 は以下のような特長を有する。

1) 未反応のエポキシ樹脂成分が適度に残存しているこ とにより、圧力がかかった場合、ゲル中より未反応成分 が浸み出すため、多量の高分子量成分やフィラーを多量 に含む場合でも接着性が良好である。

2) テルペンフェノールノボラック樹脂が低揮発性であ るため、接着フィルムと基板や半導体チップを貼り付け る際に、基材や半導体チップ等を汚染することがなく、 しかも鉛フリーはんだを想定した260℃での接着性が

3) 本発明で規定した官能基を有するアクリル系共重合 体を使用することにより、接着剤の低弾性率化を図るこ とができ、かつPCT処理後の接着性や耐電食性を付与 することができる。

4) アクリル系共重合体等の高分子量成分がゲル化して いるため、エポキシ樹脂の未反応成分が多数残存してい る場合に圧力をかけたとしても、未反応成分が極端に流 動して多量の浸み出しを発生して接続端子を覆う等の不 良が発生しない。

5)上記の効果に加えて、接着剤組成物に熱伝導性や難 燃性等を付与できる。以下、本発明に係る接着剤組成 物、これを用いた接着フィルム、この接着フィルムを用 いた半導体チップ搭載用基板及びこれを用いた半導体装 置について実施例により具体的に説明する。 [0040]

【実施例】<実施例1>以下に示す組成物より接着フィ ルムを作製した。エポキシ樹脂としてビスフェノールA 型エポキシ樹脂(エポキシ当量200、油化シェルエポ キシ(株)製商品名、エピコート828を使用)45重 量部とクレゾールノボラック型エポキシ樹脂(エポキシ 当量220、住友化学工業(株)製商品名、ESCNO 01を使用)15重量部、エポキシ樹脂の硬化剤として テルペンフェノールノボラック樹脂(油化シェルエポキ シ (株) 製商品名、エピキュアMP402を使用) 54 重量部、エポキシ基含有アクリル系共重合体としてエポ キシ基含有アクリルゴム(重量平均分子量800,00 0、帝国化学産業(株)製商品名、HTR-860P-3を使用)200重量部、硬化促進剤として1-シアノ エチルー2-フェニルイミダゾール (四国化成工業

0.5重量部、カップリング剤としてアーメルカプトプ ロピルトリメトキシシラン (日本ユニカー (株) 製商品 名、NUC A-189を使用) 2.5重量部、_アーウ レイドプロピルトリエトキシシラン(日本ユニカー (株) 製商品名、NUC A-1160を使用) 2.5 重量部からなる組成物に、メチルエチルケトン1, 25 〇重量部を加えて攪拌混合し、真空脱気した。得られた ワニスを、基材として厚さ50μmの離型処理ポリエチ レンテレフタレートフィルム上に塗布し、120℃で1 O分間乾燥して膜厚が75μmのBステージ状態の接着 10 フィルムを作製した。なおこの状態での接着剤の硬化度 は、DSC (デュポン社製商品名・912型DSC) を

【0041】<実施例2>硬化剤をテルペンフェノール ノボラック樹脂(油化シェルエポキシ(株)製商品名、 エピキュアMP402)36重量部及びビスフェノール ノボラック樹脂(大日本インキ化学工業製のLF288 2を使用) 13重量部に変更した以外は、実施例1と同 様の方法で接着フィルムを作製した。なおこの状態での 20 接着剤の硬化度は、DSCを用いて測定した結果、全硬 化発熱量の18%の発熱を終えた状態であった。

用いて測定(昇温速度、10℃/分)した結果、全硬化

発熱量の16%の発熱を終えた状態であった。

【0042】<実施例3>硬化促進剤の1-シアノエチ* 表1 配合及び塗工後の硬化度

*ルー2-フェニルイミダゾール(四国化成工業(株)製 商品名、キュアゾール2PZ-CNを使用)を0.5重 量部から0.1重量部に変更した以外は、実施例1と同 様の方法で接着フィルムを作製した。なおこの状態での 接着剤の硬化度は、DSCを用いて測定した結果、全硬 化発熱量の12%の発熱を終えた状態であった。

14

【0043】 <比較例1>硬化剤をビスフェノールノボ ラック樹脂(大日本インキ化学工業製のLF2882を 使用)25重量部に変更した以外は、実施例1と同様の 方法で接着フィルムを作製した。なおこの状態での接着 剤の硬化度は、DSCを用いて測定した結果、全硬化発 熱量の20%の発熱を終えた状態であった。

【0044】 <比較例2>硬化剤をビスフェノールノボ ラック樹脂(大日本インキ化学工業製のLF2882を 使用)25重量部に変更し、さらに硬化促進剤を0.1 重量部に変更した以外は、実施例1と同様の方法で接着 フィルムを作製した。なおこの状態での接着剤の硬化度 は、DSCを用いて測定した結果、全硬化発熱量の14 %の発熱を終えた状態であった。以上の配合及び塗工後 の硬化度を表1に示した。

[0045]

【表1】

項	目	実施例1	実施例2	実施例3	比較例1	比較例2
エポキシ樹脂	エピコート 828			45重量部		
	ESCN001			15重量部		
硬 化 剤	エピキュア MP402	54 重量部	36 重量部	54 重量部		
	LF2882		13 建量部		25 重量部	25 重量部
アクリルゴム	HTR-860P-3	200重量部				
硬化促進剤	2PZ-CN	0.5 重量部	0.5 重量部	0.1 重量部	0.5 重量部	0.1 重量部
シランカップ リング剤	NUC A-189	· 2.5 重量部				
	NUC A-1160	2.5 重量部				
硬 化 度		16%	18%	12%	20%	14%

【0046】得られた接着フィルムを用いて、揮発性成 40%160℃(両面)、圧力2MPa、圧着時間18秒の条 分量、接着強度を評価した。揮発性成分量は、一定サイ ズで切り出した接着剤を170℃の乾燥機で1時間放置 した後の重量変化により測定した。すなわち、処理前の 接着剤の重量をA(g)とする。次に170℃で1時間 乾燥した後の接着剤の重量をB(g)とすると、揮発性 成分量C(%)は、次の数2で与えられる。

【数2】C(%) = $(A-B) \times 100/A$ 接着強度はテスター産業(株)作製の熱圧着機を用い、 ガラス板とポリイミドフィルム(宇部興産株式会社製 ユーピレックス50S)の間に接着剤を挟み、金型温度※50

件で熱圧着させた後、170℃の条件下に1時間放置し 硬化反応を終了させ、テスター産業株式会社製の90度 ピール強度測定機を用いて、260℃におけるポリイミ ドフィルムの引き剥がし強度を測定し、接着剤作製時の 異なる3サンプルの平均値が20g/cm未満のものを ×、20~50g/cmの範囲内のものを△、50g/ cm以上のものを○とした。これらの結果を表2に示し た。

[0047] 【表2】

表 2 接着フィルムの揮発性成分量と接着強度

項目	実施例1	実施例2	実施例3	比較例1	比較例2
揮発性成分量	0.3%	0.5%	0.4%	2.0%	3.0%
接着強度	0	0	0	Δ	×

【0048】実施例1~3の接着剤を、基材として厚さ 25μmポリイミドフィルム (宇部興産性のユーピレッ クスSGA-25を使用)の両面に温度85℃、圧力 2.5MPa、ラミネート速度1.0m/分の条件でホ 10 ットロールラミネーターを用いて貼り付け、ポリイミド フィルムの両面に接着剤層を備えた接着フィルムを作製 した。得られた接着フィルムを用いて、図2に示すよう な半導体チップ5 (厚みが150μm) と75μmのポ リイミドフィルムを基材に用いた半導体配線基板(厚み が75μm) 4を接着剤で貼り合わせた半導体装置サン プル(片面にはんだボール8を形成)を作製し、チップ 及び基材の汚染、耐熱性、耐湿性を評価した。図2にお いて3は配線、6は半導体チップ接続部材、7は封止材 である。チップ及び基材の汚染の評価方法としては、1 20 80℃の金型温度で半導体チップと配線基板を接着剤で 貼り合わせた1,000ピースのサンプルについて、分 析を行い、汚染が10ピース以上のものを×、1~9ピ ースのものを△、0ピースのものを○とした。耐熱性の 評価方法には、耐リフロークラックと温度サイクル試験 を適用した。耐リフロークラック性の評価はサンプル表 面が260℃でこの温度を20秒間保持するように温度*

*設定した I Rリフロー炉にサンプルを通し、室温で放置 することにより冷却する処理を2回繰り返したサンプル 中の剥離及びクラックを観察することにより行った。剥 離及びクラックの発生していないものを○とし、発生し たものを×とした。温度サイクル試験はサンプルを-5 5℃雰囲気に30分間放置し、その後125℃の雰囲気 に30分放置する工程を1サイクルとして測定し、50 ○サイクルまでに破壊が生じなかったものを○で示し た。また、耐湿性評価は、プレッシャークッカー試験機 中で500時間処理(121℃、2気圧、PCT処理) 後接着部材の剥離を観察することにより行った。接着部 材の剥離の認められなかったものを○とし、剥離のあっ たものを×とした。

16

【0049】比較例1及び2の接着剤を用いて、実施例 4と同様にポリイミドフィルムの両面に接着剤層を備え た接着フィルムを作製し、実施例4と同様に、チップ及 び基材の汚染、耐熱性、耐湿性の評価を行った。以上の 結果を表3に示した。

[0050]

【表3】

表 3 汚染、耐熱性及び耐湿性評価

項目	実施例1	実施例2	実施例3	比較例1	比較例2
チップ及び基材の汚染	0	0	0	Δ	×
耐リフロークラック性	0	0	0	×	×
温度サイクル試験	0	0	0	0	0
耐湿性評価	0	0	0	0	×

[0051]

【発明の効果】本発明の接着剤組成物、これを用いた接 着フィルム及びこの接着フィルムを用いた半導体装置 は、室温付近での弾性率が低いために、半導体装置にお 40 いて、半導体チップと配線基板との熱膨張率差から加熱 冷却時に発生する熱応力を緩和させることができる。ま た、本発明の接着剤組成物及びこれを用いた接着フィル ムは、特に260℃の高温における接着性が高いため、 リフロー時の剥離やクラック発生が認められず、耐熱性 に優れている。またエポキシ基含有アクリル系共重合体 を低弾性率成分として含む場合は耐湿性、特にPCT処 理等厳しい条件下で耐湿試験を行った場合の劣化が少な く優れた特長を有する接着剤、接着フィルム及びこれを 用いた半導体装置を提供することができる。さらに本発※50 6 半導体チップ接続部材

- ※明の接着剤組成物及びこれを用いた接着フィルムは、硬 化剤の揮発性が低いためにチップや基材に対する汚染が 少なく、パッケージの信頼性を向上することができる。
- 【図面の簡単な説明】
 - 【図1】本発明になる接着フィルムの断面図

【図2】本発明になる接着フィルムを用いた半導体装置 の断面図

【符号の説明】

- 1 接着剤
- 2 基材
- 3 配線
- 4 半導体配線基板
- 5 半導体チップ

(10)

特開2002-180021

18

7 封止材

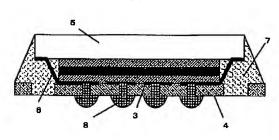
8 はんだボール

【図1】

17



【図2】



フロントページの続き

HO1L 21/60

(51) Int. Cl. 7.

識別記号

311

FΙ HO1L 21/60 テーマコード(参考)

311S

Fターム(参考) 4J004 AA10 AA12 AA13 AB01 AB05

CA04 CA06 CB03 EA05 FA05

FA08

4J036 AA01 AA05 AK08 DA02 DA05

FA03 FA10 FA12 FA13 FB03

FB06 JA06 KA01

4J040 DB042 DF042 DF052 EB071

EC071 GA05 GA07 GA11

GA22 HB09 HB19 HC03 HC11

HC22 HC25 HD04 HD25 HD32

HD36 JA02 JB02 JB09 KA16

KA17 KA21 KA23 LA01 LA02

LA06 MA10 MB03 NA20 PA30

PA33

5F044 KK02 KK03